

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-166775

(43)Date of publication of application : 25.06.1996

(51)Int.Cl.

G09G 3/36

G02F 1/133

G09F 9/35

(21)Application number : 06-309236

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 13.12.1994

(72)Inventor : SHIRAKI ICHIRO

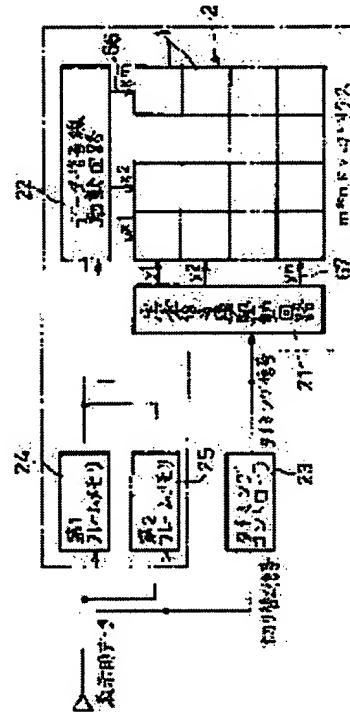
KUBOTA YASUSHI

(54) PICTURE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve mounting efficiency and to decrease a manufacturing cost by applying driver monolithic technology.

CONSTITUTION: This device is constituted of MOS transistors arranged to respective pixels 1... as a switching element for driving the pixels 1, a scanning signal line driving circuit 21 and a data signal line driving circuit 22 transmitting a driving signal based on display data to the MOS transistor through data signal lines 67 and a scanning signal lines 66, and a first frame memory 24 and a second frame memory 25 storing display data outputted to these driving circuits 21, 22 by one frame unit and provided on the outside of pixels on the same substrate.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 10.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3207693

[Date of registration] 06.07.2001

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-166775

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51)Int.Cl ⁶	識別記号	序内整理番号	P I	技術表示箇所
G 0 9 G 3/36				
G 0 2 F 1/133	5 0 5			
G 0 9 P 9/35	3 0 5	7426-5H		

審査請求 本願求 請求項の数 5 OL (全 16 頁)

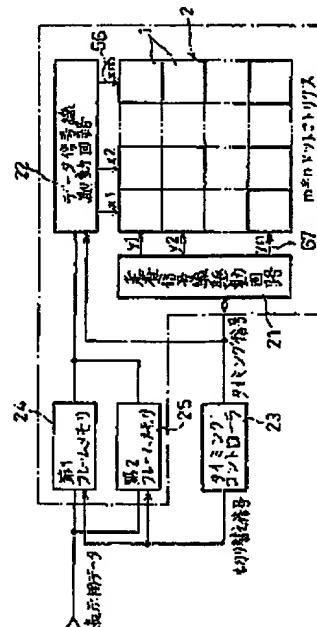
(21)出願番号 特願平6-309236	(71)出願人 000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(22)出願日 平成6年(1994)12月13日	(72)発明者 白木 一郎 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内
	(72)発明者 久保田 純 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内
	(74)代理人 弁理士 原 謙三

(54)【発明の名稱】 画像表示装置

(57)【要約】

【構成】 画素1を駆動するためのスイッチング素子として各画素1…に配されたMOSトランジスタと、データ信号線67…及び走査信号線66…を介してMOSトランジスタに表示用データに基づく駆動信号を伝送する走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22と、これら駆動回路21・22に出力するための表示用データを1フレーム単位で記憶し、かつ画素外に設けられる第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25とが同一基板上に形成されている。

【効果】 ドライバモノリシック技術を応用することにより、実装効率の向上及び低コスト化を図ることができる。



(2) 特開平8-166775

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数のデータ信号線と、それらデータ信号線に対して交差する複数の走査信号線とを備えると共に、表示用データに基づき画像を表示するための各画素が、隣り合う各データ信号線及び隣り合う各走査信号線により囲まれた位置にそれぞれ配置された画素アレイによりなる画像表示装置において、上記画素を駆動するためのスイッチング素子として各画素に配列されたMOSトランジスタと、

上記データ信号線及び走査信号線を介して上記MOSトランジスタに表示用データに基づく駆動信号を伝送する駆動回路と、

上記駆動回路に出力するための表示用データを1フレーム単位で記憶し、かつ画素内に設けられるメモリ手段とが同一基板上に形成されていることを特徴とする画像表示装置。

【請求項2】上記メモリ手段は少なくとも2つの区分メモリ手段に区分される一方、上記表示用データにおける新たな1フレーム分の一方の区分メモリ手段への記憶と他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しどとを交互に切り替えて行わせる切替手段と、

上記一方の区分メモリ手段による表示用データの新たな1フレームを記憶する期間内に、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しを2回以上回行うことにより同一表示用データを同一画素に2回以上繰り返して書き込ませる繰り返し手段とが設けられていることを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。

【請求項3】上記メモリ手段をDRAM構成、SRAM構成又はEEPROM構成としたことを特徴とする請求項1又は2記載の画像表示装置。

【請求項4】上記MOSトランジスタと駆動回路及びメモリ手段を構成する各画素とは、多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっていることを特徴とする請求項1、2又は3のいずれかに記載の画像表示装置。

【請求項5】上記基板は電気絶縁性を有するガラス基板からなっており、上記各手段を構成する素子が600°C以下のプロセス温度で形成されていることを特徴とする請求項1、3又は4のいずれかに記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、マトリクス状に表示用画素を有する画像表示装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】薄型パネルディスプレイとして代表的なものの一つにアクティブラチタリクス型の液晶表示装置が知られている。上記アクティブラチタリクス型の液晶表示装置では、図12に示すように、液晶容量71及び補助容量72からなる画素容量73と非晶質シリコンからな

10

2

る薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)スイッチング素子(以下、「TFT」と称する)74とからなる画素75を、図13に示すように、マトリクス状に配列して画素アレイ70として形成し、これを表示用電極基板として用いている。

【0003】上記の画素75はガラス板等の光透過型の絶縁基板上に形成されており、この絶縁基板上には、図12に示すように、その他に、TFT74に接続されて画素75を駆動するためのデータ信号線76や走査信号線77等の各配線も併せて形成されている。そして、これら各画素75…が隣り合う各データ信号線76…及び隣り合う各走査信号線77…により囲まれた位置にそれぞれ配置されたものとなっている。

【0004】この種の液晶表示装置は、画像の表示品位が高く、また表示用電極基板として利用される絶縁基板の面積の大きさに制約が少なく、かつ反射型、透過型のいずれにも適用可能なため、広く実用に供されている。

【0005】ところで、液晶表示装置では、スイッチング素子を備えた画素にデータ信号及び走査信号を供給するための駆動回路を表示用電極基板に接続する必要がある。

【0006】駆動回路と表示用電極基板との接続方法としては、ポリイミド樹脂薄膜ベース等に鋼導線を多数形成してなる接続フィルムを用いるフィルムキャリア方式や表示用電極基板上に直接駆動回路を実装するCOG(Chip On Glass)方式等がある。

【0007】これに対し、近年では表示用電極基板におけるスイッチング素子の形成に際して、駆動回路とスイッチング素子とを一体形成し、回路素子の実装効率を向上させるドライバモノリシック技術の開発が行われている。

【0008】しかし、スイッチング素子として一般的に用いられる非晶質シリコン薄膜を半導体層とした非晶質シリコンのTFTを用いたのでは駆動能力が不足し、ドライバモノリシック技術を実現させるには困難である。

【0009】そこで、駆動能力の高い多結晶シリコン薄膜を半導体層とした多結晶シリコンのTFTを用いたドライバモノリシック技術の開発が進められている。

【0010】ここで、一般的なドライバモノリシック型アクティブラチタリクス画像表示装置について詳述する。

【0011】図14に示すように、多結晶シリコンからなるTFTを用いたMOS(Metal Oxide Semiconductor)トランジスタは、絶縁基板81に多結晶シリコンからなる半導体層82を形成し、次いで、ゲート絶縁膜83及びゲート電極84を形成した後、半導体層82にソース電極85及びドレイン電極86を形成し、さらに、層間絶縁膜87及び金属配線層88・89を形成した後、保護膜90を形成した構造である。

【0012】上記ゲート電極84は上記走査信号線77に、ソース電極85はデータ信号線76に、並びにドレ

(3)

特開平8-166775

3

イン電極86は液晶容量71及び補助容量72に接続されている。なお液晶容量71及び補助容量72の反対側の端子は共通電極に接続されている。

【0013】また、上記各データ信号線76…は、表示用データを供給するデータ信号線駆動回路78に接続され、各走査信号線77…は走査信号を供給する走査信号線駆動回路79にそれぞれ接続されている。そして、上記データ信号線駆動回路78及び走査信号線駆動回路79は、これらにタイミング信号を送るタイミングコントローラ80に接続されている。

【0014】上記タイミングコントローラ80は、図13に示すように、各画素75…に表示すべきデータの電圧、及び表示を行う際の位置決めを行うための水平、垂直同期信号等を生成し、これら信号を基にデータ信号線駆動回路78にて1水平期間分の表示用データをサンプリングし、このサンプリングされた信号をタイミングコントローラ80にて生成した転送信号により上記データ信号線76に出力する。

【0015】一方、走査信号線駆動回路79では、図12に示すように、走査信号線77がアクティブ状態であるときにデータ信号線76上を送られている表示用データが TFT74を介して液晶容量71に書き込まれる。液晶容量71に書き込まれた電荷により液晶層の透過率、或いは反射率が変調され表示が維持される。そして、表示用データの垂直周波数が60Hzであればインターレース方式では1/30秒、ノンインターレース方式では1/60秒で1画面の表示、つまり1フレームが完了する。

【0016】ところで、液晶容量71にはこの液晶容量71と並列に比較的高抵抗の抵抗成分が存在すると共に、OFF状態のTFT74にも抵抗成分が存在する。このため、蓄積された電荷がこれら抵抗成分を介してリーキし、次のフレームによって再びこの画素75に表示用データが書き込まれるまでに画素電極の電位が変化する。さらに、ドライバモノリシック技術を実現するためには不可欠である多結晶シリコンのTFTをスイッチング素子として用いた場合には、該トランジスタのOFF特性は非晶質シリコンのTFTと比較すると劣悪であるために、さらに表示品位の劣化を招いていた。したがって、上記不具合を低減するために液晶容量と並列に比較的大きな値を有する補助容量72を設けることが通常とされている。

【0017】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の液晶表示装置では、ドライバモノリシック技術を実現するために必要不可欠である多結晶シリコンのTFT74をスイッチング素子として用いた場合、この多結晶シリコンのTFT74のOFF特性が非晶質シリコンのTFT74と比較すると劣悪であるために、表示電位が減衰して画素75に書き込まれた表示用データが十分保

4

持されないという表示品位の劣化等が問題となっていた。

【0018】また、上記不具合を低減するために液晶容量71と並列に比較的大きな値を有する補助容量72を設けるという対策が施されているが、この補助容量72の存在によって画素75の開口率が低下していた。

【0019】そこで、これらの問題を解決するために、表示用データを各画素の補助容量で保持するのではなく、画素外に各画素に対応させて設けたメモリを用いて表示用データを保持する構成が提案できる。

【0020】しかしながら、上記画素外にメモリを設け、メモリを形成する基板と画素アレイを形成する基板とを別々にした場合には、その接続が煩雑となり、画像表示装置の実装効率を向上させるというドライバモノリシック技術の利点を損なうという問題点を有している。

【0021】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、多結晶シリコンTFTをスイッチング素子として用いた場合においても、ドライバモノリシック技術を実現し得ると共に、多結晶シリコンTFTのOFF特性の不足を補い、画素開口率の向上を図り、良好な表示品位を確保し得る画像表示装置を提供することにある。

【0022】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の画像表示装置は、上記課題を解決するために、複数のデータ信号線と、それらデータ信号線に対して交差する複数の走査信号線とを備えると共に、表示用データに基づき画像を表示するための各画素が、隣り合う各データ信号線及び隣り合った走査信号線により囲まれた位置にそれぞれ配置された画素アレイよりなる画像表示装置において、上記画素を駆動するためのスイッチング素子として各画素に配列されたMOSトランジスタと、上記データ信号線及び走査信号線を介して上記MOSトランジスタに表示用データに基づく駆動信号を伝送する駆動回路と、上記駆動回路に出力するための表示用データを1フレーム単位で記憶し、かつ画素外に設けられるメモリ手段とが同一基板上に形成されていることを特徴としている。

【0023】請求項2記載の発明の画像表示装置は、上記課題を解決するために、請求項1記載の画像表示装置において、上記メモリ手段は少なくとも2つの区分メモリ手段に区分される一方、上記表示用データにおける新たな1フレーム分の一方の区分メモリ手段への記憶と他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しとを交互に切り替えて行わせる切替手段と、上記一方の区分メモリ手段による表示用データの新たな1フレームを記憶する期間内に、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しを2回以上回行うことにより同一表示用データを

(4)

特開平8-166775

5

同一画素に2回以上繰り返して書き込ませる繰返書き込手段とが設けられていることを特徴としている。

【0024】請求項3記載の発明の画像表示装置は、上記課題を解決するために、請求項1又は2記載の画像表示装置において、上記メモリ手段をDRAM(Dynamic Random Access Memory)構成、SRAM(Static Random Access Memory)構成又はEEPROM(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory)構成としたことを特徴としている。

【0025】請求項4記載の発明の画像表示装置は、上記課題を解決するために、請求項1、2又は3のいずれかに記載の画像表示装置において、上記MOSトランジスタと駆動回路及びメモリ手段を構成する各素子とは、多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっていることを特徴とする請求項1、2又は3のいずれかに記載の画像表示装置。

【0026】請求項5記載の発明の画像表示装置は、上記課題を解決するために、請求項1、3又は4のいずれかに記載の画像表示装置において、上記基板は電気絶縁性を有するガラス基板からなっており、上記MOSトランジスタ、駆動回路、及びメモリ手段の各手段を構成する素子が600°C以下のプロセス温度で形成されていることを特徴としている。

【0027】

【作用】請求項1の構成によれば、画素を駆動するMOSトランジスタと、駆動信号を伝送する駆動回路と、表示用データを1フレーム単位で記憶するメモリ手段とが同一基板上に形成されている。これにより、実装効率の向上及び低コスト化を図ることができる。

【0028】請求項2の構成によれば、新たに1フレーム分の表示用データは、切替手段によって、少なくとも2つの区分メモリ手段のいずれかに記憶される。そして、一方の区分メモリ手段への記憶が行われる期間内に、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの駆動回路への読み出しが上記切替手段によって行われる。そして、切替手段は、上記少なくとも2つの区分メモリ手段への記憶と読み出しとを交互に切り替えて行わせる。これによって、表示データの記憶と各駆動手段への読み出しとを同時にを行うことができる。

【0029】一方、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しに際しては、一方の区分メモリ手段によって表示用データの新たに1フレームを記憶させる期間内に、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しを2回以上行うことにより繰返書き込手段が同一表示用データを同一画素に2回以上書き込ませる。

【0030】この結果、新たに1フレームの表示用データが記憶される期間内に、同一表示用データを同一画素

に繰り返し書き込ませるので、画素に要求されるデータ保持時間が短縮され、保持率が向上する。したがって、多結晶シリコン TFT をスイッチング素子として用いた場合においても、多結晶シリコン TFT のOFF特性の不足を補い、良好な表示品位を確保することができる。

【0031】また、各画素の補助容量を廃止するか又は補助容量の該当容量を小さくすることができるので、画素開口率の向上を図ることができ、かつ画素回路規模の縮小を図り、ひいては良品率の向上及び高精細化が可能となる。

【0032】また、請求項3の構成によれば、上記メモリ手段をDRAM構成、SRAM構成、又はEEPROM構成としているので、既存のDRAM、SRAM又はEEPROMの技術を活用して、MOSトランジスタ、駆動回路及びメモリ手段を同一基板上に容易に形成することができる。

【0033】一方、スイッチング素子として一般的に用いられる非晶質シリコン薄膜を半導体層とした非晶質シリコン TFT を用いたのでは、駆動能力が不足し、ドライバモジュラリック技術を実現させるには困難である。

【0034】しかし、請求項4の構成によれば、MOSトランジスタは、駆動能力が高い多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっているので、メモリ手段及び駆動回路とスイッチング素子とをモジュラリックに形成することができる。

【0035】しかも、メモリ手段は、フレーム周期以下の時間毎にデータを書き換えることにより、リーク電流の大きい多結晶シリコン TFT を用いたメモリにおいても、リークによるデータの消失を防ぐことができ、これによって、通常のDRAMで行われているようなリフレッシュ動作を必要としない。また、多結晶シリコン薄膜を用いたMOSトランジスタのOFF特性の不足を充分に補うことができる。

【0036】また、請求項5の構成によれば、基板上に形成されるMOSトランジスタ、駆動回路及びメモリ手段を構成する素子がプロセス温度600°C以下で形成されているので、安価な低融点のガラス基板が使用可能となり、これによって、装置の大型化、低コスト化が可能となる。

40 【0037】

【実施例】

【実施例1】本発明の一実施例について図1ないし図7に基づいて説明すれば、以下の通りである。

【0038】本実施例の画像表示装置としての例は、液晶表示装置は、アクティブラチクス型の液晶表示装置に適用されるものであり、図1に示すように、複数の画素1-1をm×nのマトリクス状に配した画素アレイ2を有している。

【0039】上記画素1は、図2に示すように、液晶容量61及び補助容量62からなる画素容量63と多結晶

(5)

7

シリコンの半導体層からなるMOS (Metal Oxide Semiconductor)トランジスタ64とからなっている。

【0040】また、画素1はガラス基板等の光透過型の後述する絶縁基板5上に形成されており、この絶縁基板5上には、MOSトランジスタ64に接続されて画素1を駆動するためのデータ信号線66や走査信号線67も併せて形成されている。そして、隣り合う各データ信号線66…及び隣り合う各走査信号線67…により囲まれた位置に各画素1…がそれぞれ配置されたものとなっている。

【0041】上記の各データ信号線66…及び各走査信号線67…は、図1に示すように、画素アレイ2の構で上記絶縁基板5上に一体に形成された駆動回路としての走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22にそれぞれ接続されると共に、後述する第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25も合わせてこの絶縁基板5上に形成されている。したがって、同図において一点鎖線で示す各画素1…のMOSトランジスタ64…、走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22、並びに第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25が同一絶縁基板5上に形成されていることになり、これによって、回路素子の実効率を向上させるドライバモノリシック技術の適用が図られている。以下、これらの構造を順に説明する。

【0042】上記の走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22は、保証音込手段としてのタイミングコントローラ23に接続されている。また、データ信号線駆動回路22は、メモリ手段としての第1フレームメモリ24又は第2フレームメモリ25を介して表示用データに接続される一方、上記第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25には、切替手段としての上記タイミングコントローラ23からの切替信号がそれぞれ入力されている。

【0043】上記タイミングコントローラ23は、各画素1…に表示すべきデータの電圧、及び表示を行う際の位置決めを行うための水平・垂直同期信号等を生成し、これらの信号を基にデータ信号線駆動回路22にて1水平期間分の表示用データをサンプリングする。次いで、タイミングコントローラ23は、サンプリングされた上記信号をタイミングコントローラ23で生成した転送信号によりデータ信号線66に出力する。

【0044】上記の第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25は、書き込みと読み出しとを1フレーム毎、すなわちフレーム周波数が60Hzの場合には1.6.67 msec毎に交互に行う。なお、1フレームとは、画素アレイ2全体で表示される完結した1画像をいう。

【0045】また、本実施例においては、上記メモリ手段及び一方の区分メモリ手段としての第1フレームメモリ24並びにメモリ手段及び他方の区分メモリ手段とし

特開平8-166775

8

ての第2フレームメモリ25は、合計2つのメモリに区分されているが、必ずしもこれに限らず、それ以上の数でも良い。

【0046】ところで、本実施例では、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25を構成するメモリセルは、図3に示すように、スイッチング素子とキャパシタとを備えたDRAMと同様の構造を有している。なお、第1フレームメモリ24又は第2フレームメモリ25におけるメモリ容量は、下記の条件を満たすように構成されている。

【0047】メモリ容量を画素数×色数×階調数ここで、色数は、カラーでは3、白黒では1となる。また、階調数は、256階調では8、64階調では6、8階調では3となる。

【0048】上記の第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25を形成する場合には、まず、絶縁基板5上に、多結晶シリコンからなる半導体層8及び多結晶シリコン半導体からなる第1容量電極9を形成し、これらの上にゲート絶縁膜10を形成する。次いで、半導体層8におけるゲート絶縁膜10の上にゲート電極11を形成する一方、第1容量電極9におけるゲート絶縁膜10の上に第2容量電極12を形成する。

【0049】次いで、上記の半導体層8にはソース電極13及びドレイン電極14を形成する。さらに、層間絶縁膜15を形成した後、後述するピットライン7となる金属配線16、ドレイン電極14と第2容量電極12とを接続する金属配線17、及び中間電位であるHVC端子と第1容量電極9とを接続する金属配線18を形成する。最後に保護膜19を形成する。

【0050】上記の構成は、図4に示す回路と等価になっており、半導体層8等から形成されるスイッチング素子であるメモリ用MOSトランジスタ4と第1容量電極9及び第2容量電極12からなるデータ保持容量3とが一体化して1つのメモリセルとして形成されており、DRAM (Dynamic Random Access Memory) と同様の構成となっている。

【0051】上記のメモリ用MOSトランジスタ4における上記金属配線16はピットライン7に接続される一方、上記のゲート電極11はワードライン6に接続される。

【0052】また、メモリ用MOSトランジスタ4のドレイン電極14がデータ保持容量3に接続される。

【0053】そして、ワードライン6に所定の電圧を印加することによりメモリ用MOSトランジスタ4がONし、ピットライン7に供給される表示用データがデータ保持容量3に記憶される。また、読み出しも同様に、ワードライン6に所定の電圧を印加するとメモリ用MOSトランジスタ4がONし、データ保持容量3に記憶されている表示用データがピットライン7を通して読み出される。したがって、本実施例の液晶表示装置における第

(5)

特開平8-166775

9

1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25は、DRAMと同様の動作を行う。しかも、通常のDRAMでは外部にリフレッシュ回路が必要であるが、本実施例の駆動法においては、後述するように、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25を使用して、1フレーム期間の $1/2$ 毎、すなわちフレーム周波数が60Hzの場合には、 $16.67 \times 1/2$ [msec] 毎に表示用データが読み出し及び書き込みされるので、これによって該リフレッシュ回路を不要とすることができる。

【0054】さらに、本実施例では、絶縁基板5は、安価な低融点のガラス基板を使用しており、上記の画素1のMOSトランジスタ64、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25、並びに走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22も600°C以下のプロセス温度で形成されている。

【0055】上記の構成を有する液晶表示装置の動作について説明する。図5に示すように、最初の状態では、上記タイミングコントローラ23にて生成された切り替え信号により第1フレームメモリ24が書き込みを行い、第2フレームメモリ25が読み出しを行うモードになっているものとする。ただし、第2フレームメモリ25には既に1フレーム前の表示用データが記憶されているものとする。

【0056】この状態で、第1フレームメモリ24は、1フレーム期間内に現フレームの表示用データを書き込み、記憶する。

【0057】この動作と平行して第2フレームメモリ25は、既に記憶されている1フレーム前の表示用データの読み出しを1フレーム期間内に2回（2は2以上の整数）繰り返して行う。この読み出された1フレーム前の表示用データは、図1に示すように、データ信号線駆動回路22に入力され、タイミングコントローラ23からのタイミング信号によりサンプリングされ、データ信号線66に出力される。

【0058】これと同時にタイミングコントローラ23からのタイミング信号により走査信号線駆動回路21からも走査信号が outputされ表示用データが所定の画素1に書き込まれる。

【0059】すなわち、タイミングコントローラ23は、第2フレームメモリ25の読み出し速度に対応して、1フレーム期間（フレーム周波数が60Hzの場合には $16.67/2$ [msec]）以内でn本分の走査信号が outputできるようなタイミングで走査信号線駆動回路21を動作させると共に、それぞれの走査信号のパルス内でm個の表示用データのサンプリングと書き込みとを行えるような周波数でデータ信号線駆動回路22も動作させる。この結果、データ信号線駆動回路22及び走査信号線駆動回路21の動作周波数は、1フレーム期間内に各画素1…に1回表示用データを書き込む動作を行

10

った場合の動作周波数の2倍となる。

【0060】このように、本実施例の液晶表示装置では、画素1…を駆動するMOSトランジスタ64と、駆動信号を伝送する走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22と、表示用データを1フレーム単位で記憶する第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25とが同一絶縁基板5上に形成されている。これにより、実装効率の向上及び低コスト化を図ることができると。

【0061】また、これらを全て同一絶縁基板5上に形成することによって、既存プロセスにデータ保持容量3の製造工程のみを追加することによって、又は補助容量62と同様の工程でモノリシックに形成可能な第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25を用いることによって、さらに実装効率の向上及び低コスト化を図ることができる。

【0062】また、本実施例の液晶表示装置では、新たな1フレーム分の表示用データは、タイミングコントローラ23によって、第1フレームメモリ24又は第2フレームメモリ25のいずれかに記憶される。そして、例えば、第1フレームメモリ24への記憶が行われる期間内に、第2フレームメモリ25における既に記憶された1フレーム分の表示用データの走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22への読み出しが上記タイミングコントローラ23によって行われる。そして、タイミングコントローラ23は、上記2個の第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25への記憶と読み出しとを交互に切り替えて行わせる。これによって、表示データの記憶と各駆動回路21・22への読み出しとを同時に行うことができる。

【0063】一方、第2フレームメモリ25における既に記憶された1フレーム分の表示用データの走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22への読み出しに際しては、タイミングコントローラ23が、第1フレームメモリ24によって表示用データの新たな1フレームを記憶させる期間内に、第2フレームメモリ25における既に記憶された1フレーム分の表示用データの走査信号線駆動回路21及びデータ信号線駆動回路22への読み出しを2回以上の2回行うことにより、1フレーム期間内に、同一表示用データを同一画素1に2回以上の2回書き込ませる。

【0064】この結果、新たな1フレームの表示用データが記憶される期間内に、同一表示用データを同一画素1に繰り返し書き込ませるので、画素1に要求されるデータ保持時間が短縮され、保持率が向上する。すなわち、図6に示すように、画素容量63の電位は、時間の経過に伴い減衰するが、これを必要電位にまで減衰する時間T₁以内に再度電位を高めることによって、絶えず表示の必要電位を確保することができる。したがって、多結晶シリコンTFTをスイッチング素子として用いた

(7)

特開平8-166775

11

場合においても、多結晶シリコン TFT の OFF 特性の不足を補い、良好な表示品位を確保することができる。

【0065】また、各画素 1…の補助容量 62 を廃止するか又は補助容量 62 の該容量値を小さくすることができるので、画素開口率の向上を図ることができ、かつ画素回路規模の縮小を図り、ひいては良品率の向上及び高精細化が可能となる。

【0066】また、本実施例の液晶表示装置は、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 がDRAM と同様の構造となっており、既存のDRAM の技術を活用することができる。

【0067】さらに、DRAM 構成として、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 の占める面積を小さくすることができる。

【0068】一方、スイッチング素子として一般的に用いられる非晶質シリコン薄膜を半導体層とした非晶質シリコン TFT を用いたのでは、駆動能力が不足し、ドライバモノリシック技術を実現させるには困難である。

【0069】しかし、本実施例では、MOS トランジスタ 64 は、多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっているので、従来用いていた非晶質シリコンよりも大幅にキャリア移動度を稼ぐことができ、駆動能力が高い。また、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 及び走査信号線駆動回路 21 及びデータ信号線駆動回路 22 を構成する各素子も同様に多結晶シリコン薄膜を用いることでモノリシックに形成することができる。

【0070】しかも、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 は、フレーム周期以下の時間毎にデータを書き換えるので、リーク電流の大きい多結晶シリコン TFT を用いたメモリにおいても、リークによるデータの消失を防ぐことができ、これによって、通常のDRAM で行われているようなリフレッシュ動作を必要としない。さらに、多結晶シリコン薄膜を用いたMOS トランジスタ 64 のOFF 特性の不足を充分に補うことができる。

【0071】また、絶縁基板 5 上に形成されるMOS トランジスタ 64、データ信号線駆動回路 22 及び走査信号線駆動回路 21、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 を構成する素子がプロセス温度 600 °C 以下で形成されているので、安価な低融点のガラス基板が使用可能となり、これによって、装置の大型化、低コスト化が可能となる。

【0072】なお、本発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。例えば、上記実施例では、データ信号線駆動回路 22 は、デジタル信号入力用となっているが、特にこれに限定するものではなく、例えば、アナログ信号入力用としても可能である。

【0073】すなわち、データ信号線駆動回路 22 がアナログ信号入力用の場合には、図 7 に示すように、アナ

12

ログ表示用データをデジタル信号に変換するA/Dコンバータ 31 を第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 への入力前に設けると共に、第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 とデータ信号線駆動回路 22 との間に、D/Aコンバータ 32 及び恒性反転回路 33 を直列に接続する。上記D/Aコンバータ 32 は、デジタル信号をもとのアナログ表示用データに変換するものである。また、恒性反転回路 33 は、図 8

(a) ~ (d) に示すように、画素アレイ 2 における各画素 1…の液晶に同一方向にのみ境界をかけていると液晶の寿命が短くなるので、1フレーム毎にフレーム反転、フレーム+1 水平ライン反転、フレーム+1 垂直ライン反転又はフレーム+ドット反転等の反転を行うものである。なお、この反転駆動は、デジタル信号入力の場合にも必要なものである。

【0074】これによって、アナログ表示用データにおいても、画像表示が可能となる。

【0075】また、上記第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 は、上述の構成に限らず、いかなる能動素子を用いても良く、例えばMIM (Metal Insulator Metal) 素子等を用いることも可能である。さらに、第1容量電極 9 及び第2容量電極 12 の構成も既存プロセスにおける導電性材料であることが望ましいが、他の材料を用いても所定の容量が得られればいかなる構成であっても良い。

【0076】【実施例 2】本発明の他の実施例を図 9 及び図 10 に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施例 1 の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。

【0077】本実施例の液晶表示装置におけるフレームメモリは、図 9 に示すように、前記第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 を構成する各メモリセルが多結晶シリコンのメモリトランジスタ 41 からなっている。

【0078】上記の多結晶シリコンのメモリトランジスタ 41 からなる第1フレームメモリ 24 及び第2フレームメモリ 25 を形成する場合には、図 10 に示すように、まず、絶縁基板 5 上に、多結晶シリコンからなる半導体層 8 を形成し、この上に第1ゲート絶縁膜 10a 及びフローティングゲート 42 を積層する。上記半導体層 8 には n 型の不純物が注入されている。次いで、半導体層 8 にソース電極 13 及びドレイン電極 14 を形成する。次いで、第2ゲート絶縁膜 10b を積層し、さらにこの第2ゲート絶縁膜 10b 上にゲート電極 11 を形成する。次いで、層間絶縁膜 15 を形成した後、上記ピッターライン 7 となる金属配線 16、及びドレイン電極 14 と接続するための金属配線 44 を形成する。最後に保護膜 19 を形成する。なお、上記のゲート電極 11 はワードライン 6 に接続される。この構造は、EEPROM (E

(8)

特開平8-166775

13

lectrical Erasable Programmable Read Only Memory)と同様の構造となっている。

【0079】上記のメモリセルの動作原理を説明する。初期状態としてフローティングゲート42に電荷がない状態とする。まず、ゲート電圧11に該トランジスタの閾値電圧よりも少しでも高い電圧が印加されるとソース電圧13及びドレイン電圧14間に電流が流れるようになる。次に、フローティングゲート42に電荷がホットエレクトロン注入等で注入されている場合にゲート電圧11にプラス電圧が印加されると、フローティングゲート42の電荷によりプラス電圧が相殺されるが、さらに大きなプラス電圧を印加することによりチャネルに電子が誘起され、ソース電圧13及びドレイン電圧14間に電流が流れようになる。このようにフローティングゲート42に電子が注入されている場合に、該トランジスタがONするためにはゲート電圧11に閾値電圧よりも高い電圧を印加する必要があるように、つまり通常のゲート電圧では電流が流れないようになることができる。すなわち、フローティングゲート42中の電荷の有無によって“0”，“1”が記憶可能となる。これによって、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25をON/OFFすることができる。

【0080】このように、本実施例の液晶表示装置は、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25がEEPROMと同様の構造となっている。したがって、既存のEEPROMの技術を活用して、実施例1で説明した1フレームの期間内に繰返し書き込みを行うという駆動法の適用を図ることができる。また、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25をEEPROM構成としたことで、書き込み及び消去に時間がかかるという面もあるが、メモリの保持能力を向上させ、かつ面積も小さくできる。

【0081】なね、本実施例における第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25は、必ずしも上述の構成に限らず、例えば、フローティングゲート42を有し、該フローティングゲート42中の電荷の有無により“0”，“1”を記憶する機能を有するものであればいかなる構成であってもよい。

【0082】【実施例3】本発明の他の実施例を図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施例1及び実施例2の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。

【0083】本実施例の液晶表示装置におけるフレームメモリは、図11に示すように、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25のメモリセルが、スイッチング素子である2つの選択用MOSトランジスタ51・52と、これら選択用MOSトランジスタ51・52の間に接続される第1インバータ53及び第2インバータ54とから構成されている。

14

【0084】上記の第1インバータ53及び第2インバータ54は、第1インバータ53の出力が第2インバータ54の入力に接続され、同様に、第2インバータ54の出力が第1インバータ53の入力へと接続されたフリップフロップ構成となっている。

【0085】そして、上記選択用MOSトランジスタ51・52の他方の電極はピットライン7a及びピットライン7bにそれぞれ接続される一方、ゲート電極はワードライン6にそれぞれ接続されている。したがって、この第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25は、SRAM(Static Random Access Memory)と同様の構成となっている。

【0086】次に、上記メモリセルの動作原理について説明する。まず、選択用MOSトランジスタ51・52がON状態の時に、例えばピットライン7aに“1”が供給され、かつピットライン7bに“0”が供給されているとするとA点には“1”が、B点には“0”がフリップフロップに書き込まれ、選択用MOSトランジスタ51・52がOFF状態となてもA点には“1”が、B点には“0”が保持し続けられる。そして、再び選択用MOSトランジスタ51・52がON状態となった時に、ピットライン7aには“1”が、ピットライン7bには“0”が読み出される。

【0087】このように、本実施例の液晶表示装置では、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25の構成がSRAMと同様の構成となっている。したがって、既存のSRAMの技術を活用して、実施例1で説明した1フレームの期間内に繰返し書き込みを行うという駆動法の適用を図ることができる。また、第1フレームメモリ24及び第2フレームメモリ25をSRAM構成としたことで、メモリの保持能力を向上させることができる。

【0088】

【発明の効果】請求項1の発明の画像表示装置は、以上のように、画素を駆動するためのスイッチング素子として各画素に配されたMOSトランジスタと、上記データ信号線及び走査信号線を介して上記MOSトランジスタに表示用データに基づく駆動信号を伝送する駆動回路と、上記駆動回路に出力するための表示用データを1フレーム単位で記憶し、かつ画素に設けられるメモリ手段とが同一基板上に形成されている構成である。

【0089】これにより、実装効率の向上及び低コスト化を図ることができるという効果を有する。

【0090】請求項2の発明の画像表示装置は、以上のように、請求項1の画像表示装置において、上記メモリ手段は少なくとも2つの区分メモリ手段に区分される一方、上記表示用データにおける新たな1フレーム分の一方の区分メモリ手段への記憶と他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しとを交互に切り替えて行わせる

(9)

15

切替手段と、上記一方の区分メモリ手段による表示用データの新たな1フレームを記憶する期間内に、他方の区分メモリ手段における既に記憶された1フレーム分の表示用データの上記駆動回路への読み出しを2回以上行うことにより同一表示用データを同一画素に2回以上繰り返して書き込ませる繰返書き込手段とが設けられている構成である。

【0091】これにより、新たな1フレームの表示用データが記憶される期間内に、同一表示用データを同一画素に繰り返し書き込ませるので、画素に要求されるデータ保持時間が短縮され、保持率が向上する。したがって、多結晶シリコン TFT をスイッチング素子として用いた場合においても、多結晶シリコン TFT の OFF 特性の不足を補い、良好な表示品位を確保することができる。

【0092】また、各画素の補助容量を廃止するか又は補助容量の該容量値を小さくすることができるので、画素開口率の向上を図ることができ、かつ画素回路規模の縮小を図り、ひいては良品率の向上及び高精細化が可能となるという効果を奏する。

【0093】請求項3の発明の画像表示装置は、以上のように、請求項1又は2の画像表示装置において、上記メモリ手段をDRAM構成、SRAM構成又はEEPROM構成とした構成である。

【0094】これにより、既存のDRAM、SRAM又はEEPROMの技術を活用することができるという効果を奏する。

【0095】請求項4の発明の画像表示装置は、以上のように、請求項1、2又は3のいずれかの画像表示装置において、上記MOSトランジスタと駆動回路及びメモリ手段を構成する各素子とは、多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっている構成である。

【0096】これにより、MOSトランジスタは、駆動能力が高い多結晶シリコン薄膜を半導体層としてなっているので、メモリ手段及び駆動回路とスイッチング素子とをモノリシックに形成することができる。

【0097】特に、請求項2のような区分メモリ手段から各画素に表示用データを複数回書き込むことにより、多結晶シリコン薄膜を用いたMOSトランジスタのOFF特性の不足を充分に補うことができるという効果を奏する。

【0098】請求項5の発明の画像表示装置は、以上のように、請求項1、3又は4のいずれかの画像表示装置において、上記基板は遮光絶縁性を有するガラス基板からなっており、上記各手段を構成する素子が600°C以下のプロセス温度で形成されている構成である。

【0099】これにより、安価な低融点のガラス基板が使用可能となり、この結果、装置の大型化、低コスト化が可能となるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

特開平8-166775

16

【図1】本発明の一実施例における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。

【図2】上記液晶表示装置の画素を示す構造図である。

【図3】上記液晶表示装置の第1フレームメモリ及び第2フレームメモリを示す構造図である。

【図4】上記第1フレームメモリ及び第2フレームメモリの等価回路図である。

【図5】上記液晶表示装置の駆動動作を示すタイムチャートである。

10 【図6】上記液晶表示装置における画素電極の電位の減衰化を示すグラフである。

【図7】上記液晶表示装置における变形例の構成を示すブロック図である。

【図8】上記液晶表示装置における極性反転回路の動作を示す説明図であり、(a)はフレーム反転、(b)はフレーム+1H反転、(c)はフレーム+1V反転、(d)はフレーム+1ドット反転を示すものである。

【図9】本発明の他の実施例における液晶表示装置の第1フレームメモリ及び第2フレームメモリの構造を示す等価回路図である。

20 【図10】上記液晶表示装置の第1フレームメモリ及び第2フレームメモリを示す構造図である。

【図11】本発明のさらに他の実施例における液晶表示装置の第1フレームメモリ及び第2フレームメモリを示す等価回路図である。

【図12】従来例を示すものであり、液晶表示装置の画素の構造を示すブロック図である。

【図13】上記液晶表示装置の構成を示すブロック図である。

30 【図14】上記液晶表示装置の画素を示す構造図である。

【符号の説明】

- 1 画素
- 2 画素アレイ
- 3 データ保持容量
- 4 メモリ用MOSトランジスタ
- 5 ワードライン
- 6 ピットライン
- 7 21 走査信号駆動回路(駆動回路)
- 22 データ信号駆動回路(駆動回路)
- 23 タイミングコントローラ(切替手段、繰返書き込手段)
- 24 第1フレームメモリ(メモリ手段、一方の区分メモリ手段)
- 25 第2フレームメモリ(メモリ手段、他方の区分メモリ手段)
- 61 液晶容量
- 62 給助容量
- 63 画素容量
- 59 64 MOSトランジスタ

66 データ信号線

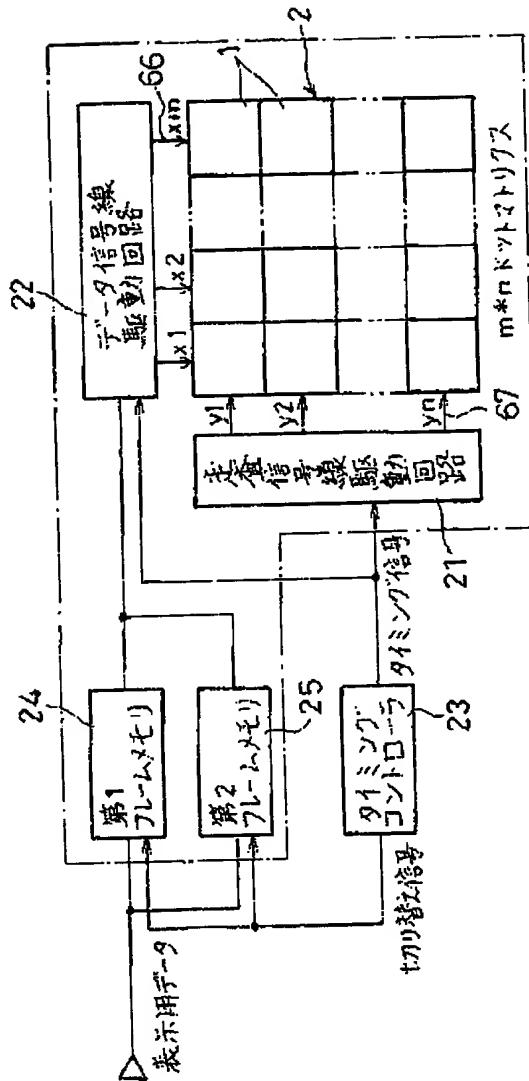
(10)

特開平8-166775

18

* * 67 走査信号線

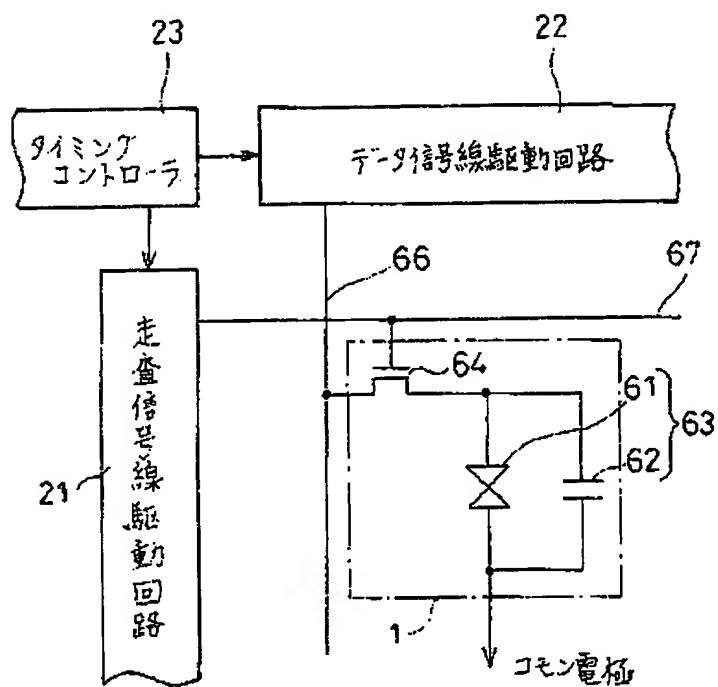
[図1]



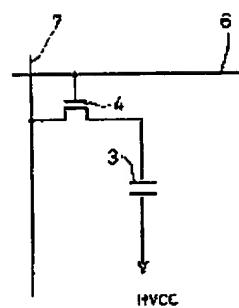
(11)

特開平8-166775

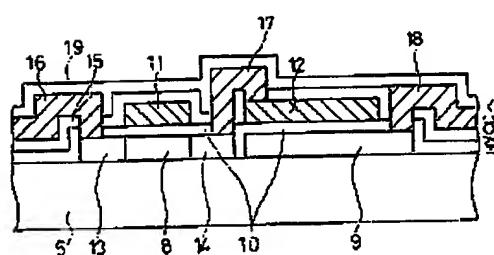
【図2】



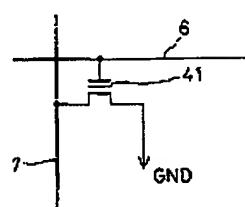
【図4】



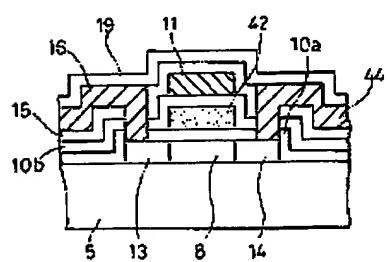
【図3】



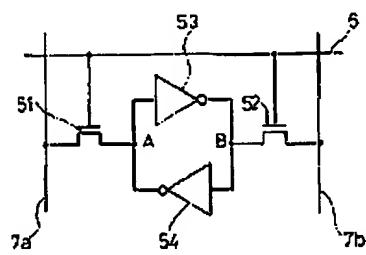
【図9】



【図10】



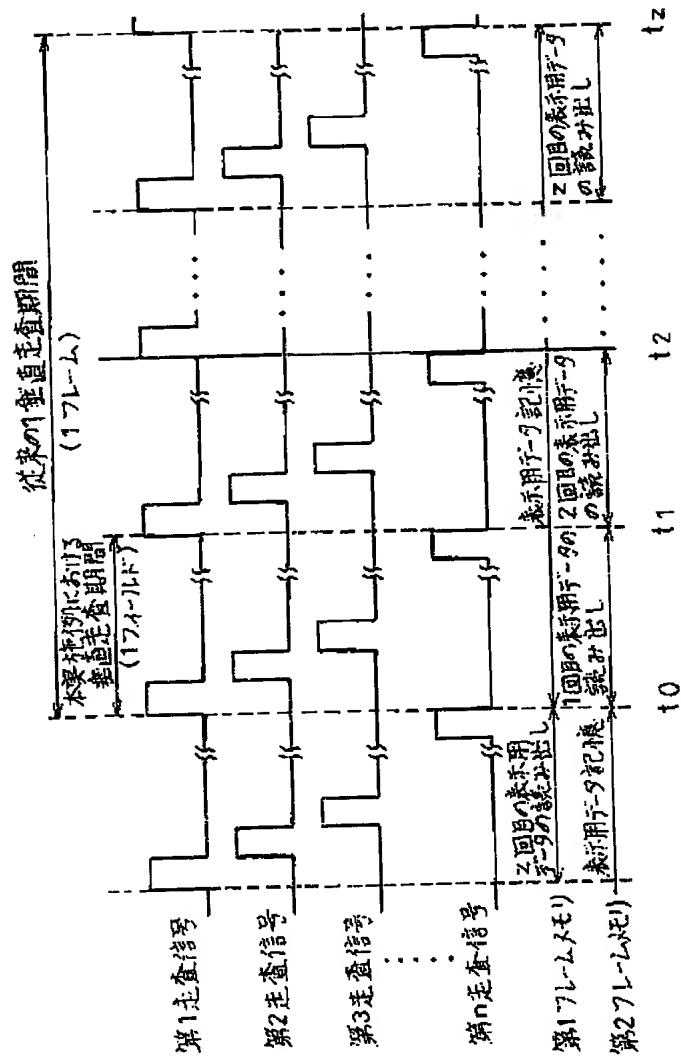
【図11】



特開平8-166775

(12)

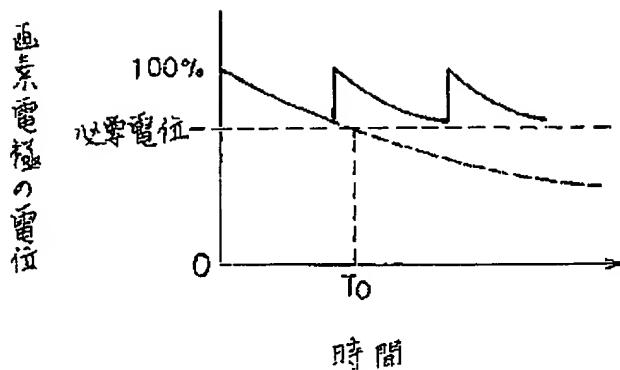
[図5]



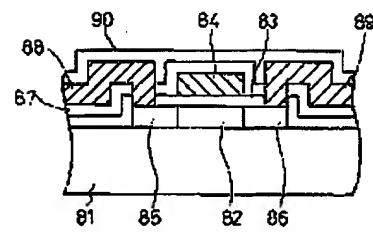
(13)

特開平8-166775

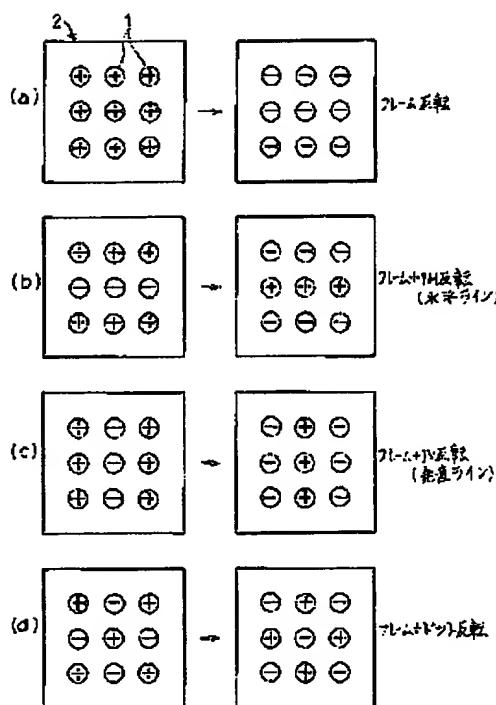
【図6】



【図14】



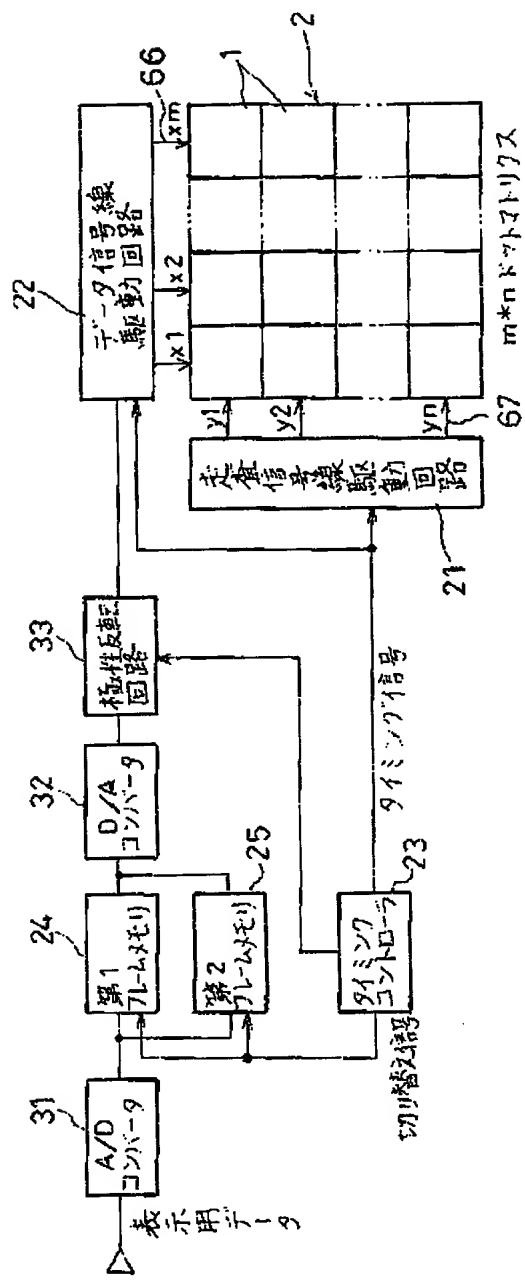
【図8】



(14)

特開平8-166775

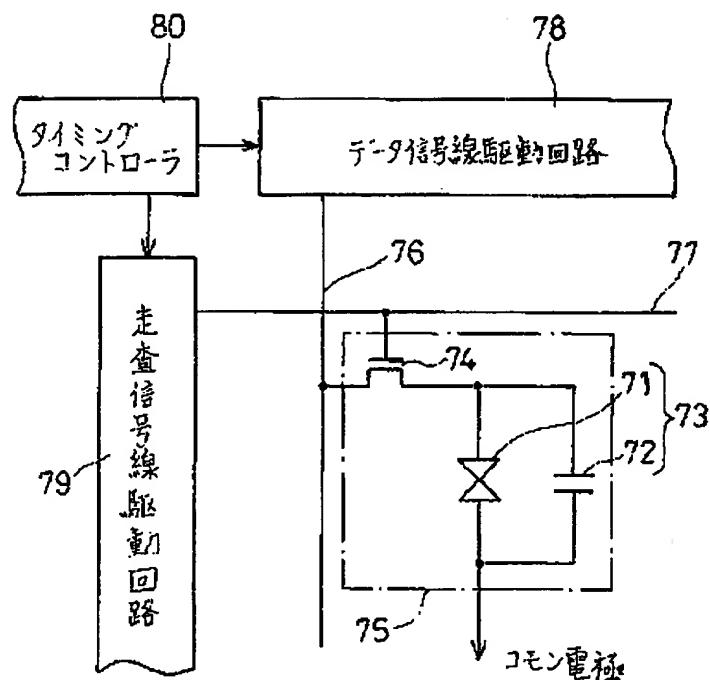
[図7]



(15)

特開平8-166775

【図12】



(15)

特開平8-166775

【図13】

